

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成30年6月21日 (2018.6.21)

【公表番号】特表2017-515907(P2017-515907A)

【公表日】平成29年6月15日 (2017.6.15)

【年通号数】公開・登録公報2017-022

【出願番号】特願2017-512434(P2017-512434)

【国際特許分類】

C 0 7 D 499/87 (2006.01)

C 0 7 F 7/18 (2006.01)

A 6 1 K 31/431 (2006.01)

A 6 1 P 31/04 (2006.01)

【F I】

C 0 7 D 499/87

C 0 7 F 7/18 V

A 6 1 K 31/431

A 6 1 P 31/04

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月14日 (2018.5.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

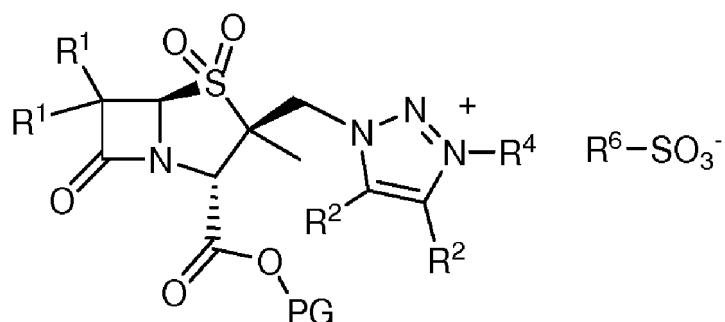
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 (I I I a) :

【化 1】



式 (IIIa)

(式中、

R¹ は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、C₁ - 5 アルキル、C₂ - 5 アルケニルおよび C₂ - 5 アルキニルから選択される；

R² は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、C₁ - 5 アルキル、C₂ - 5 アルケニルおよび C₂ - 5 アルキニルから選択される；

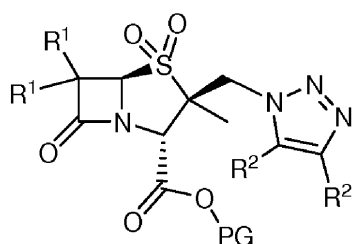
R⁴ は C₁ - 5 アルキルである；ならびに

R⁶ は C₁ - 5 フルオロアルキルである；ならびに

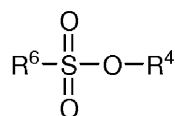
PG は保護基である) の化合物の製造方法であって、式 (I I I a) の化合物を式 (V I

I I) :

【化 2】



(IIa)



(VIII)

の化合物と反応させる工程を含む製造方法。

【請求項 2】

PG が式 SiR^3_3 の基であり、ここで、 R^3 が、各場合において、独立して、 C_{1-10} ヒドロカルビルまたは C_{1-5} アルコキシから選択される、請求項 1 記載の製造方法。

【請求項 3】

R^3 が、各場合において、独立して、 C_{1-5} アルキル、 C_{1-5} アルコキシ、フェニルおよびフェニル- C_{1-4} アルキルから選択される、請求項 2 記載の製造方法。

【請求項 4】

R^4 がメチルである、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載の製造方法。

【請求項 5】

R^6 が C_{1-5} ペルフルオロアルキルである、請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項記載の製造方法。

【請求項 6】

R^6 がトリフルオロメチルである、請求項 5 記載の製造方法。

【請求項 7】

極性非プロトン溶媒中で反応を行う、請求項 1 ~ 6 のいずれか 1 項記載の製造方法。

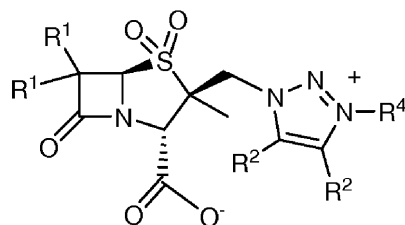
【請求項 8】

10 以下の温度で反応を行う、請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 項記載の製造方法。

【請求項 9】

式 (I V) :

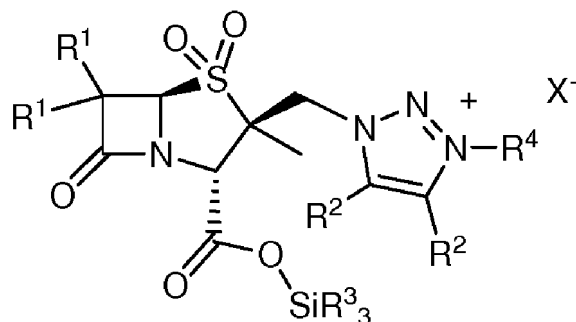
【化 3】



(IV)

(式中、 R^1 は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、 C_{1-5} アルキル、 C_{2-5} アルケニルおよび C_{2-5} アルキニルから選択される； R^2 は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、 C_{1-5} アルキル、 C_{2-5} アルケニルおよび C_{2-5} アルキニルから選択される；ならびに R^4 は C_{1-5} アルキルである) の化合物の製造方法であって、式 (I I I)

【化 4】



(III)

(式中、X⁻ はアニオンであり、各 R³ は、独立して、C₁ - 10 ヒドロカルビルおよび C₁ - 5 アルコキシからなる群から選択される) の化合物を 2 - エチルヘキサノアート塩と反応させる工程を含む製造方法。

【請求項 10】

2 - エチルヘキサノアート塩が金属 2 - エチルヘキサノアートである、請求項 9 記載の製造方法。

【請求項 11】

金属がアルカリである、請求項 10 記載の製造方法。

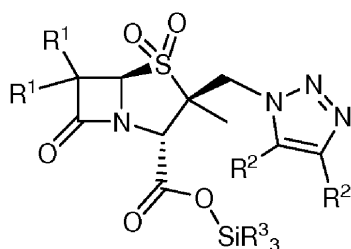
【請求項 12】

式 (III) の化合物を 2 - エチルヘキサノアート塩の溶液に加える、請求項 9 ~ 11 のいずれか 1 項記載の製造方法。

【請求項 13】

式 (I) :

【化 5】

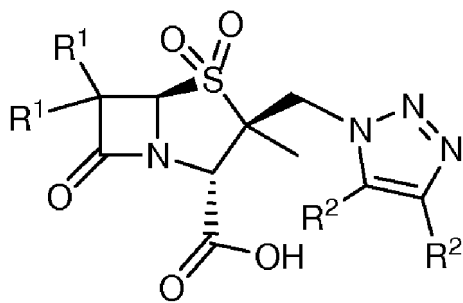


(II)

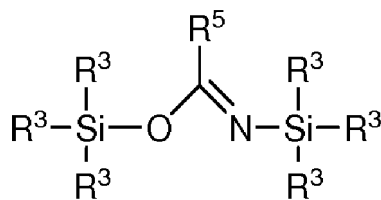
(式中、R¹ は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、C₁ - 5 アルキル、C₂ - 5 アルケニルおよび C₂ - 5 アルキニルから選択される；R² は、各場合において、独立して、H、ハロゲン、アミノ、C₁ - 5 アルキル、C₂ - 5 アルケニルおよび C₂ - 5 アルキニルから選択される；ならびに R³ は、各場合において、独立して、C₁ - 5 アルコキシおよび C₁ - 10 ヒドロカルビルから選択される) の化合物の製造方法であって、式

(I) の化合物を式 (V)

【化 6】



(I)



(V)

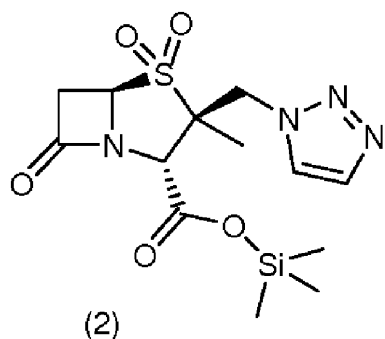
(式中、 R^5 は C_{1-5} アルキルである) の化合物の 1 モル当量未満と反応させる工程を含む製造方法。

【請求項 14】

R^3 は、各場合において、独立して、 C_{1-5} アルキル、フェニルおよびフェニル - C_{1-4} アルキルから選択される、請求項 13 に記載の方法。

【請求項 15】

式 (I I) の化合物は、式 (2)

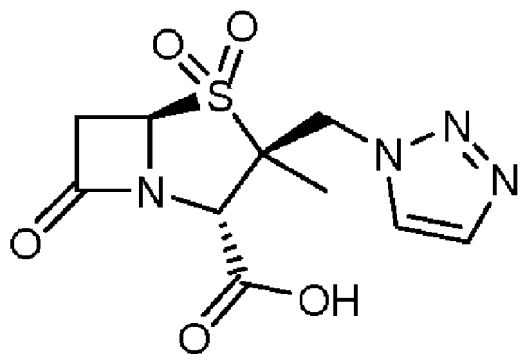


(2)

を有する、請求項 14 に記載の方法。

【請求項 16】

式 (I) の化合物は、式 (1)



(1)

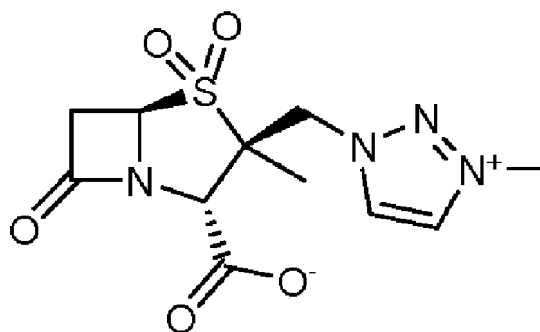
を有する、請求項 13 に記載の方法。

【請求項 17】

式 (V) の化合物は、N , O - ビストリメチルシリルアセトアミドである、請求項 1 3 に記載の方法。

【請求項 1 8】

式 (I V) の化合物は、式 (4)

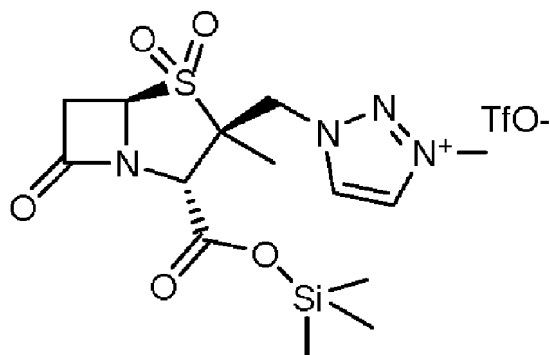


(4)

を有する、請求項 9 に記載の方法。

【請求項 1 9】

式 (I I I) の化合物は、式 (3)



(3)

を有する、請求項 9 に記載の方法。